

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年7月22日(22.07.2021)



(10) 国際公開番号

WO 2021/144982 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/027 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2020/001560

(22) 国際出願日: 2020年1月17日(17.01.2020)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人: 東邦化成株式会社(TOHO KASEI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6391031 奈良県大和郡山市今国府町6番2号 Nara (JP).

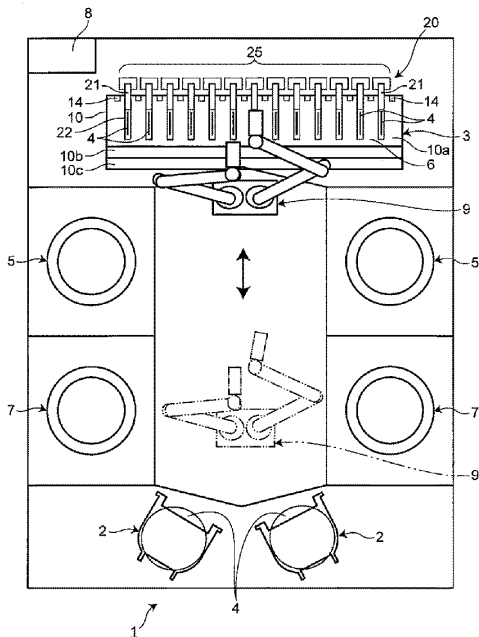
(72) 発明者: 出口 泰紀 (DEGUCHI, Yasunori); 〒6391031 奈良県大和郡山市今国府町6番2号 東邦化成株式会社内 Nara (JP).

(74) 代理人: 山尾 憲人, 外 (YAMAO, Norihito et al.); 〒5300017 大阪府大阪市北区角田町8番1号 梅田阪急ビルオフィスタワー 青山特許事務所 Osaka (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

(54) Title: LIQUID CHEMICAL PROCESSING DEVICE

(54) 発明の名称: 薬液処理装置



(57) Abstract: Provided is a liquid chemical processing device which suppresses uneven resist removal among substrates. The liquid chemical processing device comprises a processing tank 10a that removes resist by immersing substrates 4 in a liquid chemical 6, a plurality of holding units 22 that holds the substrates 4 vertically, a vertical drive unit 20 that individually drives the holding units 22 vertically, and a chucking unit 55 that detachably chucks the substrates 4, wherein the vertical drive unit 20 individually vertically moves the substrates 4 between an immersed position in which the substrates 4 are immersed in the liquid chemical 6 and a non-immersed position in which the substrates 4 are pulled out of the liquid chemical 6, so that the resist removal processing is performed on the substrates 4 held by the holding units 22 one at a time.

(57) 要約: 基板毎におけるレジスト除去にばらつきが生じることを抑制する薬液処理装置を提供する。基板4を薬液6に浸漬することによってレジスト除去処理する処理槽10aと、前記基板4を縦置きで保持する複数の保持部22と、前記保持部22を個別に上下に駆動する上下駆動部20と、前記基板4を係脱自在にチャックするチャック部55とを備え、前記上下駆動部20が、前記基板4を前記薬液6に浸漬した浸漬位置と、前記基板4を前記薬液6から引き上げた非浸漬位置との間で前記保持部22を個別に上下動させることにより、前記保持部22に保持された前記基板4が、枚葉式でレジスト除去処理される。

WO 2021/144982 A1

[続葉有]

ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))